ミクロ液相を用いた大気圧プラズマ材料プロセシング Atmospheric-pressure plasma materials processing with microdroplets

伊藤 剛仁 Tsuyohito Ito

東京大学新領域創成科学研究科

産業技術総合研究所先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリ Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo OPERANDO-OIL, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

大気圧非平衡プラズマを用いた応用研究は、 材料プロセシングのみならず、プラズマ医療や プラズマ農業など、多方面にわたる新展開を導 いてきている。その多くにおいて、液相との共 存が大きな役割を果たしているといえ、プラズ マ液相相互作用の研究の重要性が高まってい る。一方、液相をミクロ化することにより、プ ラズマの影響をより強く示す液相反応空間の 出現や新規プロセス展開が期待できる [1–3]。更 に、ミクロ液相といった疑似的に閉じた反応空 間は、新たな制御性に結びつく可能性も示唆さ れている [3]。

本発表では、ミクロ液相を時空間制御するこ とでもたらされるプラズマ援用インクジェッ トプロセスに関して、筆者らの研究成果 [4-6] を中心に報告する。インクジェットプロセスに プラズマの持つ高い反応性を付与することに より、プロセスの低温化および高速化をもたら すのみならず、更なる高付加価値化をもたらす ことが期待できる。

(1) ナノ粒子分散インクを用いた銀配線[4]

本研究では、応用に合わせて装置構成の最適 化を行っているが、その一例として、図1に銀 描画プロセスにおける装置概略図を示す。大気 圧非平衡プラズマ空間にインクジェットヘッ ドを用いてミクロ液相を吐出する構成となっ ている。インクには、銀ナノ粒子分散インクを 用い、プラズマ支援インクジェットプロセスに よる配線を、通常のインクジェットプロセスに より描画し120℃(プラズマ支援中の基板温度) で熱処理した配線と比較した。結果として、配線幅が約1/4に向上し、また約1 sのプラズマ処理 によって、約1時間の熱処理に匹敵する電気伝 導率が得られた。配線表面を中心とした局所的 な加熱のみならず、ラジカルの寄与による反応 の高速化が、プリンティングプロセスに貢献し 得ることを示す成果ととらえている。



図1. プラズマ援用インクジェットプロセスに よる銀描画装置例 [4]

(2)モノマーインクを用いたポリマー配線[5]

プラズマがもたらす反応性をより明瞭に示 す一例として、その場重合を用いた配線描画を 紹介する。ここでは、常温常圧において液相状 態である3,4-エチレンジオキシチオフェン (EDOT)をインクとして用い、プラズマから供給 される酸素ラジカルの寄与によりEDOTの重合 体であるPEDOT配線を形成した(図2)。

酸素含有プラズマを用いた場合にはPEDOT が形成されたものの、Heプラズマ環境では PEDOTの形成は確認されなかった。ドーパント としてのポリ(4-スチレンスルホン酸)(PSS) 混合量やプラズマ処理条件の最適化を含めた 更なる研究が必要と考えているものの、プラズ マが生成するラジカルを用いたインクジェッ トプロセスの実現を示す成果ととらえている。



(3)水溶液インクを用いた金配線 [6]

上述の銀配線においては、ナノ粒子分散イン クを用いたが、水溶液をインクとして用いた金 属配線の例として、塩化金酸水溶液を用いた金 配線の描画を報告する。水溶液を用いることに より、ノズルの目詰まり等の問題が生じにくく なる。

+分なプラズマ処理時間を確保するために プラズマ電極の本数を5本にし、プラズマ生成 電力を変化させて約12秒間プラズマ処理が行 われる系とした。プラズマ生成電力の増加に伴 い、生成配線中における金の割合が増加し、約 18Wの条件において塩化金の痕跡が消失した。 金描画が実現できたものの、形成された金配線 は、ナノ粒子からなる凝集体で構成されており、 現在のところ、一度の描画では十分な電気伝導 性を付与することができていない。配線材料と しての今後の課題である。

一方、形成された配線上におけるローダミン 6Gのラマン散乱測定を行い、ナノ構造体が、ラ マン散乱強度の増強をもたらすことを確認し ている。

以上の様に、大気圧非平衡プラズマは、次世 代インクジェットプロセスに、新たな機能を提 供できる可能性を秘めている。一方、再現良く ミクロ液相をプラズマ中に供給できる本シス テムは、プラズマ液相相互作用の理解にも役立 つと考えられる。そのため、プロセスの更なる 改良のみならず、プラズマ液相相互作用の理解 に貢献すべく、診断や計算科学を用いた取り組 みに今まで以上に注力していく必要性を感じている。

未だ研究例は限られているものの、プラズマ とプリンティングプロセスとの重畳に関する 研究は世界各地から報告されるようになって きている。本シンポジウムを通じ、より多くの 研究者がプラズマ援用インクジェットプリン ティングに興味を持っていただき、日本発の技 術革新につながっていくことを期待したい。

謝辞

本研究は、科学研究費補助金若手研究(A)およ び基盤研究(B)の助成を受けております。研究成 果は、産業技術総合研究所の清水禎樹博士、東 京大学の寺嶋和夫教授、妻木正尚氏、新田魁洲 氏、川野倫弥氏、石角健氏、Suyeon Jeon氏らと の共同研究によるものであり、ここに謝意を表 します。

References

- [1] K. Takenaka and Y. Setsuhara, Droplet-Vaporization Behavior during Plasma-Assisted Mist Chemical Vapor Deposition of Zinc Oxide Films, Plasma Sources Sci. Technol. 28, 065015 (2019).
- [2] K. Takenaka, Y. Okumura, and Y. Setsuhara, Low-Temperature Deposition of Zinc Oxide Film by Plasma-Assisted Mist Chemical Vapor Deposition, Jpn. J. Appl. Phys. 51, 08HF05 (2012).
- [3] M. Tsumaki, Y. Shimizu, and T. Ito, Size-Controlled Sub-Micrometer Spheroidized ZnO Particles Synthesis via Plasma-Induced Processing in Microdroplets, Materials Letters 166, 81 (2016).
- [4] M. Tsumaki, K. Nitta, S. Jeon, K. Terashima, and T. Ito, Development of Plasma-Assisted Inkjet Printing and Demonstration for Direct Printing of Conductive Silver Line, J. Phys. D: Appl. Phys. 51, 30LT01 (2018).
- [5] K. Nitta, M. Tsumaki, T. Kawano, K. Terashima, and T. Ito, *Printing PEDOT from EDOT via Plasma-Assisted Inkjet Printing*, J. Phys. D: Appl. Phys. **52**, 315202 (2019).
- [6] K. Nitta, K. Ishizumi, Y. Shimizu, K. Terashima, and T. Ito, One-Step Gold Line Fabrication from Particle-Free Inorganic Salt-Based Ink via Atmospheric Pressure Nonequilibrium Plasma-Assisted Inkjet Printing, Materials Chemistry and Physics 258, 123836 (2021).